REC'D 0 4 JAN 2005

WIFO

PÇŤ

05.11.2004

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年11月 7日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-378904

[ST. 10/C]:

[JP2003-378904]

出 願 人
Applicant(s):

東亞合成株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年12月16日

ふ 四



【書類名】

特許願

【整理番号】

B51107G2

【あて先】

特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県名古屋市港区船見町1番地の1東亞合成株式会社高分子材

料研究所内

【氏名】

佐内 康之

【特許出願人】

【識別番号】

000003034

【氏名又は名称】

東亞合成株式会社

【代表者】

山寺 炳彦

【電話番号】

(03) 3597–7224

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

043432

【納付金額】 21,000円

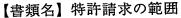
【提出物件の目録】

【物件名】

特許請求の範囲 1

【物件名】 【物件名】

明細書 1 要約書 1



【請求項1】

下記一般式(1)で表されるジ(メタ)アクリレート(A)及び下記一般式(2)で表さ れるモノ (メタ) アクリレート (B) からなり、 (A) 成分及び (B) 成分の合計量を基 準として、(A)成分を10~90質量%及び(B)成分を90~10質量%を含有する ことを特徴とする活性エネルギー線硬化型光学材料用組成物。

【化1】

[式(1)において、 R_1 及び R_3 は、それぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し、 R_2 及び R_4 は、それぞれ独立して、水素原子、メチル基又はエチル基を表わし、 $R_5 \sim R_8$ は、それぞれ独立して、水素原子、メチル基又は臭素原子を表し、1及びmは、それぞれ 独立して、1~6の整数を表す。〕

【化2】

$$H_{2}C = \stackrel{R_{9}}{C} \stackrel{O}{\longrightarrow} O \xrightarrow{\stackrel{R_{10}}{\longleftarrow} O} O \xrightarrow{\stackrel{C}{\longleftarrow} H_{3}} \stackrel{CH_{3}}{\longleftarrow} (2)$$

〔式 (2) において、R9及びR10は、それぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し 、 n は 0 ~ 3 の整数である。〕

【請求項2】

前記一般式 (1) において、R1及びR3が、いずれも水素原子を有するジアクリレートで ある請求項1記載の活性エネルギー線硬化型光学材料用組成物。

【請求項3】

さらに光重合開始剤 (C) を含有することを特徴とする請求項1又は請求項2記載の活性 エネルギー線硬化型光学材料用組成物。

【書類名】明細書

【発明の名称】活性エネルギー線硬化型光学材料用組成物

【技術分野】

[0001]

本発明は、活性エネルギー線硬化型光学材料用組成物に関するものであり、活性エネルギー線硬化型組成物、並びにレンズシート及びプラスチックレンズ等の光学材料の技術分野に属するものである。

【背景技術】

[0002]

従来、フレネルレンズ及びレンチキュラーレンズ等のレンズシートは、プレス法及びキャスト法等の方法により、成形して製造されていた。

しかしながら、前者のプレス法は加熱、加圧及び冷却のサイクルで製造するため、生産性が悪いという問題があった。又、後者のキャスト法は、金型にモノマーを流し込んで重合するため製作時間が長くかかるとともに金型が多数個必要なため、製造コストが上がるという問題があった。

[0003]

一方、活性エネルギー線硬化型組成物は、速硬化性を有し、生産性に優れているため、 前記問題を解決するため、レンズシートの製造用の活性エネルギー線硬化型組成物につい て、種々の提案がなされている(例えば、特許文献1~同6)。

[0004]

しかしながら、従来の活性エネルギー線硬化型組成物は、屈折率及び透明性の点で不十分であり、この点を改良すべく、ビスフェノール型ジ(メタ)アクリレートと芳香族環を有するモノ(メタ)アクリレートを併用した組成物が検討されている(例えば、特許文献7及び同8)。

[0005]

【特許文献1】特開昭61-177215号公報(特許請求の範囲)

【特許文献2】特開昭61-248707号公報(特許請求の範囲)

【特許文献3】特開昭61-248708号公報(特許請求の範囲)

【特許文献4】特開昭63-163330号公報 (特許請求の範囲)

【特許文献5】特開昭63-167301号公報(特許請求の範囲)

【特許文献6】特開昭63-199302号公報 (特許請求の範囲)

【特許文献 7】 特開平 9 - 8 7 3 3 6 号公報(特許請求の範囲)

【特許文献8】特許3397448公報(特許請求の範囲)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

しかしながら、前記した活性エネルギー線硬化型組成物は、プロジェクションテレビ等 の薄型化で要求される様な、さらに高度の<u>屈折率及び透明性が要求される用途では不十分</u> なものであった。

本発明者は、得られる硬化物が、高屈折率でかつ高光線透過率を有する活性エネルギー 線硬化型光学材料用組成物を見出すため鋭意検討を行ったのである。

【課題を解決するための手段】

[0007]

本発明者は、前記の課題を解決するため種々の研究した結果、特定2種の(メタ)アクリレートを含む組成物が、活性エネルギー線による硬化が速く、又その硬化物が高屈折率で、光線透過率に優れることを見出し、本発明を完成した。

以下、本発明を詳細に説明する。

尚、本明細書においては、アクリレート又はメタクリレートを(メタ)アクリレートと表す。

[0008]

本発明は、後記一般式(1)で表されるジ(メタ)アクリレート(A)及び後記一般式(2)で表されるモノ(メタ)アクリレート(B)からなり、(A)成分及び(B)成分の合計量を基準として、(A)成分を $10\sim90$ 質量%及び(B)成分を $90\sim10$ 質量%を含有する活性エネルギー線硬化型光学材料用組成物に関する。

以下、それぞれの成分について説明する。

[0009]

<u>1. (A)</u>成分

(A) 成分は、下記一般式 (1) で表されるジ (メタ) アクリレートである。

[0010]

【化1】

[0011]

[式 (1) において、 R_1 及び R_3 は、それぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し、 R_2 及び R_4 は、それぞれ独立して、水素原子、メチル基又はエチル基を表わし、 $R_5 \sim R_8$ は、それぞれ独立して、水素原子、メチル基又は臭素原子を表し、1及びmは、それぞれ独立して、 $1 \sim 6$ の整数を表す。〕

[0012]

 R_1 及び R_3 としては、組成物が硬化性に優れるものとなるため、いずれも水素原子が好ましい。 R_2 及び R_4 としては、得られる硬化物の屈折率に優れるため、いずれも水素原子が好ましい。 $R_5 \sim R_8$ としては、 $R_5 \sim R_8$ の全てが水素原子のもの、 R_5 が水素原子で R_6 がメチル基で、かつ R_7 が水素原子で R_8 がメチル基のもの、並びに R_5 が水素原子で R_6 が臭素原子で、かつ R_7 が水素原子で R_8 が臭素原子のものが、(A)成分を製造する際の収率が高く、さらに得られる硬化物の屈折率に優れるため好ましい。

1 及び $_{
m m}$ はとしては、 $1\sim3$ のものが、得られる硬化物の屈折率に優れるため好ましい

[0013]

(A) 成分の具体例としては、ビス(4-メタクリロキシエトキシフェニル)スルフィド、ビス(4-アクリロキシエトキシフェニル)スルフィド、ビス(4-メタクリロキシジエトキシフェニル)スルフィド、ビス(4-メタクリロキシジエトキシフェニル)スルフィド、ビス(4-メタクリロキシトリエトキシフェニル)スルフィド、ビス(4-メタクリロキシトリエトキシフェニル)スルフィド、ビス(4-メタクリロキシジエトキシー3-メチルフェニル)スルフィド、ビス(4-メタクリロキシジエトキシー3-メチルフェニル)スルフィド、ビス(4-メタクリロキシエトキシー3-ブロモフェニル)スルフィド、ビス(4-メタクリロキシエトキシー3-ブロモフェニル)スルフィド、ビス(4-メタクリロキシジエトキシー3-ブロモフェニル)スルフィド及びビス(4-アクリロキシジエトキシー3-ブロモフェニル)スルフィド等が挙げられる。

[0014]

これらの中でも、硬化性に優れることから、ビス(4ーアクリロキシエトキシフェニル)スルフィド、ビス(4ーアクリロキシジエトキシフェニル)スルフィド、ビス(4ーアクリロキシエトキシー3ーメチルフェニル)スルフィド及びビス(4ーアクリロキシジエトキシー3ーメチルフェニル)スルフィドがより好ましい。

(A) 成分は、一種又は二種以上を併用することができる。

[0015]

2. (B) 成分

(B) 成分は、下記一般式 (2) で表される (メタ) アクリレートであり、組成物の硬化物に高屈折率を付与し、組成物を取り扱いやすい液状にする成分である。

[0016] 【化2】

[0017]

[式(2)において、R9及びR10は、それぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し 、nは0~3の整数である。〕

[0018]

- (B) 成分の具体例としては、例えば、p-クミルフェノール (メタ) アクリレート、 p-クミルフェノールのエチレンオキサイド付加物の(メタ)アクリレート及びp-クミ ルフェノールのプロピレンオキサイド付加物の(メタ)アクリレート等が挙げられる。
- (B) 成分としては、組成物の硬化物の屈折率に特に優れる点で、 n = 0 の化合物、即 ち p - クミルフェノール (メタ) アクリレートが好ましい。
 - (B) 成分は、一種又は二種以上を併用することができる。

[0019]

尚、本発明の(B)成分と異なる、フェニル基を1個有する(メタ)アクリレートは、 組成物の硬化物が高屈折率を有するものとならない。

[0020]

3. その他の成分

本発明の組成物は、活性エネルギー線の照射により硬化するものであるが、この場合の 活性エネルギー線としては、電子線、可視光線及び紫外線等が挙げられる。これらの中で も、特別な装置を必要とせず、簡便であるため、可視光線又は紫外線が好ましい。

可視光線又は紫外線硬化型組成物とする場合、組成物に光重合開始剤を配合する。尚、 電子線硬化型組成物とする場合は、光重合開始剤を必ずしも配合する必要はない。

光重合開始剤〔以下(C)成分という〕の具体例としては、ベンゾイン、ベンゾインメ チルエーテル及びベンゾインプロピルエーテル等のベンゾイン;アセトフェノン、2,2 ージメトキシー2ーフェニルアセトフェノン、2,2ージエトキシー2ーフェニルアセト フェノン、1, 1ージクロロアセトフェノン、1ーヒドロキシシクロヘキシルフェニルケ トン、2ーメチルー1ー[4ー(メチルチオ)フェニル]ー2ーモルフォリノープロパンー 1-オン及びN,N-ジメチルアミノアセトフェノン等のアセトフェノン;2-メチルア ントラキノン、1-クロロアントラキノン及び2-アミルアントラキノン等のアントラキ ノン;2,4-ジメチルチオキサントン、2,4-ジエチルチオキサントン、2-クロロ チオキサントン及び2,4-ジイソプロピルチオキサントン等のチオキサントン;アセト フェノンジメチルケタール及びベンジルジメチルケタール等のケタール;ベンゾフェノン 、メチルベンゾフェノン、4,4′ージクロロベンゾフェノン、4,4′ービスジエチル アミノベンゾフェノン、ミヒラーズケトン及び4-ベンゾイルー4' ーメチルジフェニル サルファイド等のベンゾフェノン;並びに2,4,6-トリメチルベンゾイルジフェニル ホスフィンオキサイド等が挙げられる。

(C) 成分は、単独で使用しても、2種以上を併用しても良い。

[0021]

(C) 成分には、必要に応じて光増感剤を併用することができる。光増感剤としては、 N, N-ジメチルアミノ安息香酸エチルエステル、N, N-ジメチルアミノ安息香酸イソ アミルエステル、トリエチルアミン及びトリエタノールアミン等が挙げられる。

[0022]

(C) 成分の好ましい配合割合としては、(A) 成分及び(B) 成分との合計量100 質量部に対して、後記する不飽和基含有化合物を配合する場合には(A)成分、(B)成 分及び不飽和基含有化合物の合計量100質量部に対して、0.05~12質量部が好ま

しく、より好ましくは0.1~5質量部である。

[0023]

本発明の組成物には、必要に応じて、(A)及び(B)成分以外の不飽和基含有化合物を配合することができる。

当該不飽和基含有化合物としては、例えば、フェノキシエチル(メタ)アクリレート、カルビトール(メタ)アクリレート、N-ビニルカプロラクトン、アクリロイルモルホリン、グリシジル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、1, 4-プタンジオールモノ(メタ)アクリレート、1, 6-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、1, 1, 10 と 11 に 11 に 12 に 13 に 14 に 15 に 15 に 16 に 17 に 17 に 17 に 18 に 19 に

不飽和基含有化合物の好ましい配合割合は、組成物中に 0 ~ 5 0 質量%の範囲である。 【 0 0 2 4】

前記成分以外にも、必要に応じて、顔料、染料、消泡剤、レベリング剤、無機フィラー、有機フィラー及び光安定剤、酸化防止剤及び紫外線吸収剤等を配合することもできる。 又、必要に応じて、酸化防止剤、光安定剤、紫外線吸収剤及び重合禁止剤等を少量添加してもよい。

[0025]

本発明の組成物は、さらに硬化を進行させる目的で、組成物に熱重合開始剤を配合し、活性エネルギー線照射後に、加熱させることもできる。

熱重合開始剤としては、種々の化合物を使用することができ、有機過酸化物及びアゾ系 開始剤が好ましい。

有機過酸化物の具体例としては、1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)2-メチルシ クロヘキサン、1, 1 – ビス(t – ヘキシルパーオキシ) - 3, 3, 5 – トリメチルシク ロヘキサン、1, 1-ビス(t-ヘキシルパーオキシ)シクロヘキサン、1, 1-ビス(t ープチルパーオキシ) $\mathsf{-3}$, $\mathsf{3}$, $\mathsf{5}\mathsf{-}\mathsf{b}$ リメチルシクロヘキサン、 $\mathsf{1}$, $\mathsf{1}\mathsf{-}\mathsf{b}$ ス($\mathsf{t}\mathsf{-}\mathsf{b}$ ブチルパーオキシ)シクロヘキサン、2,2-ビス(4,4-ジープチルパーオキシシク ロヘキシル) プロパン、1, 1-ビス(t-ブチルパーオキシ)シクロドデカン、t-ヘ キシルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、t-ブチルパーオキシマレイン酸、t ーブチルパーオキシー3, 5, 5ートリメチルヘキサノエート、t ーブチルパーオキシラ ウレート、2,5-ジメチル-2,5-ジ (m-トルオイルパーオキシ) ヘキサン、t-ブチルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、 t ーブチルパーオキシ2 ーエチルヘキ シルモノカーボネート、 t ーヘキシルパーオキシベンゾエート、2, 5 ージーメチルー2 , 5-ジ (ベンゾイルパーオキシ) ヘキサン、t-ブチルパーオキシアセテート、2, 2 ービス (tーブチルパーオキシ)ブタン、tーブチルパーオキシベンゾエート、nープチ ルー4, 4 - ビス (t - プチルパーオキシ) バレレート、ジー t - プチルパーオキシイソ フタレート、 α 、 α 'ービス (t ープチルパーオキシ) ジイソプロピルベンゼン、ジクミ ルパーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチルパーオキシ)へキサン、 t ープチルクミルパーオキサイド、ジーt ープチルパーオキサイド、pーメンタンハイド ロパーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-プチルパーオキシ)へキシンー 3、ジイソプロピルベンゼンハイドロパーオキサイド、 t ープチルトリメチルシリルパー オキサイド、1, 1, 3, 3ーテトラメチルブチルハイドロパーオキサイド、クメンハイ ドロパーオキサイド、 t ーヘキシルハイドロパーオキサイド及び t ープチルハイドロパー オキサイド等が挙げられる。

[0026]

アゾ系化合物の具体例としては、1,1'ーアゾビス(シクロヘキサンー1ーカルボニ トリル)、2-(カルバモイルアゾ)イソブチロニトリル、2-フェニルアゾー4-メト キシ-2, 4-ジメチルバレロニトリル、アゾジ-t-オクタン及びアゾジ-t-ブタン 等が挙げられる。

これらは単独で用いても良いし、2種以上を併用しても良い。又、有機過酸化物は還元 剤と組み合わせることによりレドックス反応とすることも可能である。

[0027]

4. 活性エネルギー線硬化型光学材料用組成物

本発明は、前記(A)成分と(B)成分を必須とするものである。

- (A) 成分及び(B) 成分の割合は、(A) 成分及び(B) 成分の合計量を基準として (A) 成分が10~90質量%で(B) 成分が90~10質量%であり、好ましくは(A) 成分が40~90質量%で(B) 成分が60~10質量%である。(A) 成分の割合 が、10質量%より少ないと、所望の屈折率が得られなくなり、一方、(A)成分の割合 が90質量%を超えると、室温で組成物が固体になってしまうことがあり、作業性に問題 を生ずる。
 - [0028]

本発明の組成物は、前記(A)及び(B)成分、必要に応じてその他の成分を、常法に 従い、攪拌・混合して製造することができる。

(A) 成分又は (C) 成分が固体である場合は、必要に応じて、攪拌・混合した後加熱 しても良く、50~100℃が好ましい。

[0029]

本発明の組成物の使用方法としては、常法に従い、組成物に活性エネルギー線を照射し 硬化させれば良い。

活性エネルギー線としては、電子線、可視光線及び紫外線等が挙げられる。これらの中 でも、特別な装置を必要とせず、簡便であるため、可視光線又は紫外線が好ましい。紫外 線照射装置としては、高圧水銀灯等が挙げられる。

活性エネルギー線の照射量及び照射時間等は、使用する組成物及び用途に応じて、適宜 設定すれば良い。

[0030]

本発明の組成物は、屈折率(25℃)が通常1.59以上、好ましくは1.60以上を 有するという高屈折率の硬化物を得ることができる。さらに、当該硬化物は、透明性にも 優れる。

[0031]

この様に、本発明の組成物の硬化物は、高屈折率かつ透明性を有するため、フレネルレ ンズ、レンチキュラーレンズ及びプリズムシート等のレンズシート、並びにプラスチック レンズ等の種々の光学材料に使用できる。

レンズシートとしては、更に詳細には、ビデオプロビェクター、プロジェクションテレ ビ及び液晶ディスプレイ等用途が挙げられる。

[0032]

本発明の組成物を使用してレンズシートを製造する例について説明する。

比較的膜厚の薄いレンズシートを製造する場合は、本発明の組成物を、目的のレンズの 形状を有するスタンパーと称される金型に塗布し、該組成物の層を設け、その層の上に透 明基板を接着させる。

次いで、透明基板側から活性エネルギー線を照射して、組成物を硬化させ、この後、金 型から剥離させる。

[0033]

一方、比較的膜厚の厚いレンズシートを製造する場合は、目的のレンズの形状を有する 出証特2004-3115173 金型と透明基板の間に、本発明の組成物を流し込む。

次いで、透明基板側から活性エネルギー線を照射して、組成物を硬化させ、この後、金型から脱型させる。

[0034]

前記透明基板としては、樹脂基板が好ましく、具体例としては、メタクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、メタクリル酸メチルースチレン樹脂及びスチレン樹脂等のシート状のものが使用できる。

前記金型としては、その材質は特に限定されないが、例えば真鍮及びニッケル等の金属、並びにエポキシ樹脂等の樹脂が挙げられる。金型の寿命が長い点で、金属製であることが好ましい。

[0035]

次に、本発明の組成物を使用して、プラスチックレンズを製造する例について説明する

例えば、本発明の組成物を、少なくとも片面が透明である鏡面研磨した金型に注入し、 活性エネルギー線を照射して硬化させ、離型することにより得る方法等が挙げられる。

この場合の金型としては、ガラス、プラスチック、又はこれらを組み合わせた2枚の鏡面研磨したモールド型と、可塑化塩化ビニル及びエチレンー酢酸ビニル共重合体等の熱可塑性樹脂製のガスケットの他、2枚のモールド型を型締め具等とを組み合わせて構成されたもの等が挙げられる。

この場合の活性エネルギー線の照射は、金型の片面又は両面に行えば良い。又、活性エネルギー線の照射と加熱とを組み合わせることもできる。

【発明の効果】

[0036]

本発明の組成物は、室温での作業性に優れたものであり、得られる硬化物は、高屈折率であり、なおかつ光線透過率も良好であり、高屈折率及び高光線透過率が要求されるレンズシート及びプラスチックレンズ等の光学部材に好適に使用できる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0037]

本発明の組成物は、(A)成分の $10\sim90$ 質量%及び(B)成分の $90\sim10$ 質量%を必須とするものである。(A)成分としては、組成物の硬化物が高屈折率となるため、 R_1 及び R_3 がいずれも水素原子のジアクリレートが好ましい。組成物としては、(C)成分を含むものが好ましい。

【実施例】

[0038]

以下に、実施例及び比較例を挙げ、本発明をさらに具体的に説明する。

尚、以下において、「部」とは質量部を意味する。

○実施例及び比較例

表1に示す各成分を、常法に従い攪拌・混合し、あらかじめ80℃に保った乾燥機中で、固体状の光重合開始剤を15分かけて加熱溶解させ、紫外線硬化型組成物を調整した。 得られた組成物を、バーコーターを用いて、室温にてOPPフィルム上に膜厚30μmに塗布した。これを、コンベアスピード10m/分、ランプ高さ10cm、出力80W/cmの高圧水銀ランプにて、紫外線照射を2回行い、硬化させた。

得られた硬化物を、以下の方法に従い評価した。それらの結果を表1に示す。

[0039]

(1) 作業性

硬化物を作製する際の組成物の扱いやすさを評価した。室温で液体であるものを○、固体又はペースト状であるものを×とした。

(2)屈折率

硬化物の屈折率(25℃)を、(株)アタゴ製アッベ屈折計DR-M2により測定した

(3) 光線透過率

硬化物の光線透過率を、日本分光(株)製V-550により測定した。

[0040]

【表1】

	組成物(部)						評価結果		
	(A)	(E	3)	その他		(C)	作業性	屈折率	光線透
	BAEPS	p-CPA	M-110	M-211B	POA	1rg184			過率(%)
実 施 例 1	5 0	5 0				5	0	1.5992	9 6
2	7 0	3 0				5	0	1.6011	9 7
3	8 0	2 0				5	0	1.6021	9 7
<i>"</i>	50		5 0			5	0	1.5952	9 6
1 0	7 0		3 0			5	0	1.5992	9 7
1 1	8 0		2 0			5	0	1.6018	9 6
比 較例1	5 0				50	5	0	1.5831	9 5
<i>"</i>	100					5	×		
<i>"</i>		5 0		5 0		5	0	1.5750	9 7

[0041]

尚、表1における略号は、以下の意味を示す。

- ・BAEPS: ビス (4-アクリロキシエトキシフェニル) スルフィド
- ·p-CPA:p-クミルフェニルアクリレート
- $\cdot M-110$: p-クミルフェノールエチレンオキサイド1モル変性アクリレート、東亞合成 (株) 製アロニックス<math>M-110
- \cdot M-211B: ビスフェノールAエチレンオキサイド4モル変性ジアクリレート、東亞合成 (株) 製アロニックスM-211B
- · POA:フェノキシエチルアクリレート
- ・ Irg184:1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、チバ・スペシャルティ
- ・ケミカルズ製イルガキュア184

[0042]

表1から明らかなように、本発明の組成物の硬化物は作業性に優れ、屈折率は、1.5 9以上の高屈折率であり、光線透過率も良好であった。

一方、 (A) 成分を含有するが、フェニル基を分子中に一つしか有していない (B) 成分と異なるフェノキシエチルアクリレートを含有する組成物(比較例 1)を用いた場合には、高屈折率の硬化物が得られなかった。又、 (A) 成分のみを用いた組成物(比較例 2)は、室温で固体であるため作業性が悪く、硬化物を得ることができなかった。又、 (B) 成分を含有するが、 (A) 成分を含有しない組成物(比較例 3)は、高屈折率の硬化物が得られなかった。

【産業上の利用可能性】

[0043]

本発明の組成物は、活性エネルギー線硬化型光学材料用組成物として、ビデオプロビェクター、プロジェクションテレビ及び液晶ディスプレイ等に使用するフレネルレンズ及びレンチキュラーレンズ等のレンズシート、並びにプラスチックレンズ等に代表される、高

屈折率及び高光線透過率を要求される光学部材に好適に使用できる。



【要約】

【課題】得られる硬化物が、高屈折率でかつ高光線透過率を有する活性エネルギー線硬化型光学材料用組成物の提供。

【解決手段】下記一般式 (1) で表されるジ (メタ) アクリレート (A) 及び下記一般式 (2) で表されるモノ (メタ) アクリレート (B) からなり、(A) 成分及び (B) 成分の合計量を基準として、(A) 成分を $10\sim90$ 質量%及び (B) 成分を $90\sim10$ 質量%を含有する活性エネルギー線硬化型光学材料用組成物。

【化1】

[式 (1) において、 R_1 及び R_3 は、それぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し、 R_2 及び R_4 は、それぞれ独立して、水素原子、メチル基又はエチル基を表わし、 $R_5 \sim R_8$ は、それぞれ独立して、水素原子、メチル基又は臭素原子を表し、1及びmは、それぞれ独立して、 $1 \sim 6$ の整数を表す。〕

【化2】

[式 (2) において、R9及びR10は、それぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し、nは0~3の整数である。]

【選択図】なし

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-378904

受付番号

5 0 3 0 1 8 4 9 5 7 7

書類名

特許願

担当官

第七担当上席 0096

作成日

平成15年11月10日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成15年11月 7日

特願2003-378904

出願人履歴情報

識別番号

[000003034]

1. 変更年月日 [変更理由] 1994年 7月14日

名称変更

住 所 氏 名 東京都港区西新橋1丁目14番1号

東亞合成株式会社